

引用信息: Su Wen-Duan; Ye Hui. Acta Phys. -Chim. Sin., 1993, 9(03): 351-356 [苏文煨;叶晖. 物理化学学报, 1993, 9(03): 351-356]

本期目录 | 在线预览 | 过刊浏览 | 高级检索

[打印本页] [关闭]

研究论文

电极/溶液界面内层形成熵的统计力学处理

苏文煨; 叶晖

厦门大学化学系, 厦门 361005

摘要:

根据文[1a]提出的电极/溶液界面偶极取向分布模型, 导出金属/溶液界面内层形成熵 $\Delta S_{-}(m-d)(\sigma)$ 以及溶剂化层构型熵 $S_{-k}(\sigma)$ 的统计力学计算式, 讨论了影响 $\Delta S_{-}(m-d)$ 变化的主要因素, 并给出对汞/甲醇、汞/碳酸亚乙酯和汞/水溶液等三种界面的处理结果.

关键词: 界面形成熵 汞/溶液界面

收稿日期 1991-12-02 修回日期 1992-06-16 网络版发布日期 1993-06-15

通讯作者: 苏文煨 Email:

本刊中的类似文章

Copyright © 物理化学学报

扩展功能

本文信息

PDF(1396KB)

服务与反馈

把本文推荐给朋友

加入我的书架

加入引用管理器

引用本文

Email Alert

文章反馈

浏览反馈信息

本文关键词相关文章

▶ 界面形成熵

▶ 汞/溶液界面

本文作者相关文章

▶ 苏文煨

▶ 叶晖